

单层氮化硼薄膜（HBN）SiO₂/Si 基 底

中文名称： 单层氮化硼薄膜（HBN）SiO₂/Si 基底

英文名称： Monolayer boron nitride film（HBN）

货 号： ML1171

CAS 号： 7440-42-8

包 装： 4 英寸/6 英寸

参 数

4 英寸圆片，SiO₂/Si 基底

6 英寸 圆片，SiO₂/Si 基底

保质期： 1年常温干燥避光密封保存

性 质

覆盖率： 100%

基 底： SiO₂/Si

晶粒尺寸： >4 um

氧化层： 300 nm

硅： 500 um

应 用： HBN 薄膜可被用作金属绝缘金属结构的超薄间隔层，以及电子的隧道阻挡层，使其具有广泛的应用，例如纳米电容器、场效应隧道晶体管。作为单分子膜还可被用作介质或基片。

其他信息： 常温干燥避光密封保存，保存期限 1 年。